卵日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-50703

@Int Cl.4

證別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988)3月3日

G 01 B 11/06

G-7625-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

膜厚測定装置 会発明の名称

> 创特 頤 昭61-196147

學出 額 昭61(1986)8月21日

砂発 明 者 菱 刈 功

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1145 株式会社千野製作所

技術センター内

の発 明 井・手 色 彦 者

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1145 株式会社千野製作所

技術センター内

孝 生 66発明者 相川

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1145 株式会社一野製作所

技術センター内

株式会社テノー ①出 願 人

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

明細書

- 1. 発明の名称 膜厚測定装置
- 2. 特許請求の範囲
- 1. 測定対象に光を投光する光源と、被測定対 象からの透過光または反射光を分光手段で分光し 干渉稿を検出する検出器と、この検出器の各波長 についての出力のうち極大値と極小値との差が所 定の値のときの極値についての出力から被測定対 象の膜厚を演算する演算手段とを備えたことを特 徴とする膜厚測定装置。
- 2. 前記検出器としてイメージセンサを用いた ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の膜 圧測定装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、光の干渉を利用して膜原を測定す る装置に関するものである。

「従来の技術」

光の干渉を利用して被測定対象の膜厚を測定す るには、故測定対象に光源よりの光を投光し、そ の透過光または反射光を分光して干渉箱を検出器 で検出し、被測定対象の膜厚を測定している。

〔この発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、被測定対象の測定スポット内で 屈折率、膜厚等にわずかのパラツキ等があると、 膜厚等の相違に応じて干渉縞のパターンが異なり これが同時に重なり合って合成されると、第3図 で示すように、うなりを生じたり、コントラスト が弱くなり、測定が困難となることがある。

また、検出器に、電荷蓄積型撮像素子CCDの あなイメージセンサを用いて、高分子フィルム 等の連続して流れている被測定対象を測定する場 合、電荷蓄積の一走査周期内に長い距離の部分を 測定すると、分光してイメージセンサに投影され る干渉箱パターンは、被測定対象の膜厚の相違に 応じて異るものとなり、これが合成されて、第3 図で示すようなうなりを生じたり、平均化されて ゴントラストが弱くなり、測定が困難となること がある。

この発明の目的は、以上の点に活み、干渉箱パ

ターンが不鮮明であっても確実に測定できるよう にした膜厚測定装置を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

この発明は、光源からの光を技測定対象に投光し、その透過光または反射光を分光して干渉協を検出器で検出し、被測定対象の膜厚を測定する装置において、検出器の各波長についての出力のうち極大値と極小値との差が所定の値のときの極性についての出力から測定対象の膜厚を演算するようにした膜厚測定装置である。

実施例]

三第1図は、この発明の一実施例を示す構成説明図である。

図において、1は、光源で、光源1からの光は、 レンズ2によりハーフミラー3を介してフィルム のような被測定対象4に投光され、被測定対象4 を透過または反射した光は、この図ではハーフミ ラー3、レンズ5、チョッパのようなシャッタ手 段6、しほり7、レンズ8を介して回析格子等の 分光手段9で分光され、レンズ10を介してCC

すると

$$d = \frac{N\cos\theta'}{2n} \frac{\lambda \cdot \lambda \cdot 2}{\lambda \cdot 2 - \lambda}$$
 (3)

となる。 被測定対象 4 に垂直に投光する $\theta'=0$ のときは $\cos \theta'=1$ で(3)式は

$$d = \frac{N}{2n} \frac{\lambda : \lambda 2}{\lambda 2 - \lambda}$$
 (4)

となる。このように、波長 λ 1 、 λ 2 、極値の次数差 N 、既知の屈折率 n から、被測定対象 4 の膜厚が (3)、 (4)式より求まる。

つまり、あらかじめ、分光手段9により検出器 119名素子に入射する波長は決まっているので 検出器11の各素子番号と波長との関係を演算手 段13のメモリに記憶しておく。

そして、測定時、検出器11の各素子の出力を 頭次読み出し、第3図で示すように、測定範囲内 で極性を与える素子番号からメモリを利用して改 長 λ - 、 λ 2 を求め、極値の数の差から次数 だい を求め、メモリ等に格納された屈折率 n を用いた (3)、(4)式のような演算を行って被測定対 Dのようなイメージセンサの検出器11に入射する。このイメージセンサ11の各素子には分光手段9で分光された各波長に対応した光が入射し、干渉福パターンの強度が検出される。イメージセンサ11の出力は増幅器12で増幅され、メモリ等を含む演算手段13で所定の演算がなされ、被測定対象4の膜厚しが演算される。

第2図で示すように、光源からの平行光線し、 し2は、膜厚(厚さ)d、屈折率nの被測定対象 4の表面および裏面で反射し、両光線し、し2 は、光学的光路差2nd/COS 8/をもち、この光路 差が光の波長の整数倍のとき干渉して第3図のような干渉稿を形成する。

$$(n \div N) \lambda_1 = 2 \text{ nd/cos } \theta'$$
 (1)

$$m\lambda 2 = 2 \text{ nd/cos } \theta' \qquad (2)$$

(2)式よりm を求め(1)式に代入して整理

象4の膜厚 む求める。

また、検出器11に電荷蓄積型服像素子CCDのようなイメージセンサを用いると、被測定対象4が移動していて、その厚さ等がずれると、やや異った干渉器パターンが検出器11の各素子に一走査周期内入射して合成され、全体としてコントラストが悪くなる。

このため、モータによりセクタが回転するチョッパのようなシャッタ手段7により入射光を断続して1回の測定時間を制限し、検出器11への入射光の変動の影響を少くし、干渉額のコントラス

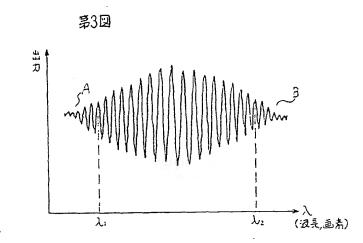
トが悪くなるのを防止し、測定を確実なものとする。

[発明の効果]

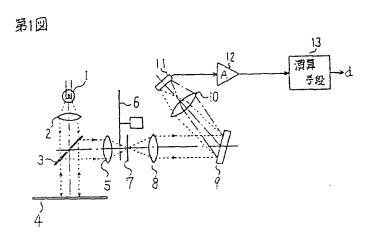
以上述べたように、この発明は、検出器の各波 長についての出力のうち極大値と極小値との差が 所定の値以上のときの極値についての出力から膜 厚を測定するようにしているので、弱い干渉箱を 拾うことなく、強い確実な干渉額から被測定対象 の膜厚の測定が高精度に可能となる。

4. 図面の簡単な説明

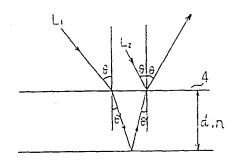
第1図、第2図は、この発明の一実施例を示す 構成説明図、第3図は、干渉箱の説明図である。 1…光源、2、5、8、10…レンズ、3…ハーフミラー、4…被測定対象、6…シャッタ手段、7…しぼり、9…分光手段、11…検出器、12…増幅器、13…演算手段



特許出願人 株式会社 千野製作所



第2回



Japanese → English \ Patent Application No.: 63-50703 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

Sho63-50703

[Specification]

- 1. Title of Invention:
 - Film Thickness Measurement Apparatus
- 2. What Is Claimed Is:
 - 1. A film thickness measurement apparatus, comprising a light source for projecting light on the measurement subject, a detector for detecting interference fringes after transmitted light or reflected light from the measurement subject is split by a splitting means, and a calculation means for calculating the film thickness of the measurement subject from the output based on a threshold value when the difference between the maximum value and minimum value of the output of each wavelength of this detector is a predetermined value.

 [portion omitted]

[Problems the Invention Is to Solve]

Nevertheless, when there is a slight randomness or the like in refractive index, film thickness, etc. within the measurement spot on the measurement subject, the

Japanese → English Patent Application No.: 63-50703 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

interference fringe pattern differs according to differences in the film thickness, etc., and when this is simultaneously superimposed and synthesized, it creates beats as shown in FIG. 3, contrast weakens, and measurement becomes difficult.

[portion omitted]

In FIG. 1, 1 is a light source; light from the light source 1 is projected by a lens 2 through a half mirror 3 onto a measurement subject 4 such as a film. Light transmitted or reflected by the measurement subject 4 [passes through] the half mirror 3, lens 5, shutter means 6 such as a chopper, diaphragm 7, lens 8, and is split by a splitting means 9 such as a diffraction grating, etc. in this drawing. It passes through a lens 10 and is incident on a detector 11 such as a CCD-type of image sensor. Light corresponding to each wavelength split by the splitting means 9 is incident on each element of this image sensor 11 and the intensity of the interference fringe pattern can be detected. The output of the image sensor 11 is amplified by an amplifier 12, predetermined calculations are

Page: 3

Japanese → English Patent Application No.: 63-50703 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

performed by a calculation means 13 that includes a memory, etc., and the film thickness d of the measurement subject 4 is calculated.

As shown in FIG. 2, parallel light beams L_1 and L_2 from the light source are reflected by the front and back of the measurement subject 4, which has film thickness (thickness) d and refractive index n, and the two light beams L_1 and L_2 have an optical path difference $2 \text{nd}/\cos\theta$. When this optical path difference is an integral multiple of the light wavelength, interference occurs and the sort of interference fringe shown in FIG. 3 is formed.

Given an interference fringe pattern as shown in FIG. 3, if smallest wavelength λ_1 and largest wavelength λ_2 provide the extremes of the measurement region and each order of interference is m \div N, m, the following equations are established.

$$(m \div N) \lambda_1 = 2nd/cos\theta'$$
 (1)

$$m\lambda_2 = 2nd/\cos\theta ' \qquad (2)$$

If we find m using equation (2), substitute it in equation (1), and rearrange it, this gives us:

Page: 5

Japanese → English Patent Application No.: 63-50703

Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

thickness as described above based on the output for the extreme values when the difference between the maximum value and the minimum value in the output of each wavelength of the detector 11 equals or exceeds a predetermined value. As a result, the film thickness d of the measurement subject 4 can be measured from strong and reliable interference fringes without involving the unreliable and weak interference fringes.

[portion omitted]

* * *

While all translations are carefully prepared and reviewed, please note that liability for incidental or consequential damages occasioned by omissions, additions, or differences of interpretation shall not exceed the translation fee.

				•
			4	î
		40		